Резонансное отражение света периодической системой экситонов в квантовых ямах GaAs/AIGaAs

© В.В. Чалдышев[¶], Е.В. Кунделев⁺, Е.В. Никитина^{*}, А.Ю. Егоров^{*}, А.А. Горбацевич^{*}

Физико-технический институт им .А.Ф. Иоффе Российской академии наук,

194021 Санкт-Петербург, Россия

⁺ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,

195251 Санкт-Петербург, Россия

* Санкт-Петербургский академический университет — научно-образовательный центр нанотехнологий Российской академии наук,

194021 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 28 февраля 2012 г. Принята к печати 7 марта 2012 г.)

Проведены исследования спектров оптического отражения от периодических структур с двумя квантовыми ямами в элементарной ячейке. Изучены зависимости брэгговского и экситон-поляритонного отражения от угла падения света, поляризации и температуры. Анализ данных зависимостей показал, что образец с 60 ячейками является хорошим распределенным брэгговским отражателем с коэффициентом отражения более 90% в максимуме спектральной полосы шириной 16 мэВ.

Структуры с периодически изменяющимся в пространстве показателем преломления (фотонные кристаллы) позволяют создавать разрешенные и запрещенные энергетические зоны для фотонов [1], что весьма интересно как с фундаментальной, так и с прикладной точек зрения. В частности, одномерные фотонные кристаллы являются основой для создания брэгговских отражателей и диэлектрических зеркал, которые широко применяются в оптических и электрооптических приборах, например, в вертикально-излучающих полупроводниковых лазерах (vertical cavity surface emitting lasers, VCSELs) [2]. Особый интерес представляют структуры, в которых возможно управлять фотонной запрещенной зоной [3], тем самым активно управлять потоками фотонов.

Разновидностью одномерных фотонных кристаллов являются резонансные брэгговские структуры (РБС) [4]. В таких структурах периодическая модуляция диэлектрической функции реализуется за счет экситонных состояний в квантовых ямах (КЯ). При этом, когда брэгговская периодичность системы квантовых ям совпадает с частотой квазидвумерных экситонов в КЯ, возникает коллективная суперизлучательная экситонполяритонная мода, сила осциллятора которой пропорциональна числу квантовых ям. В пределе бесконечного числа ям формируется фотонная запрещенная зона. С точки зрения оптических свойств при падении света из внешней среды РБС представляет собой брэгговский полосовой отражатель. При этом функциональность отражателя обеспечивается системой экситонов в квантовых ямах. Таким отражателем можно управлять, например, путем приложения внешнего электрического поля, меняющего энергетические параметры экситонов (эффект Штарка) [5].

Исследованию свойств РБС было посвящено весьма значительное количество теоретических работ [6-13],

в которых были проанализированы различные аспекты формирования суперизлучательной моды. Экспериментальные доказательства существования коллективной суперизлучательной моды были получены для квантовых ям CdTe/CdMgTe [14], GaAs/InGaAs [15–18], GaAs/AlGaAs [19–23] и InGaN/GaN [24]. Следует отметить, что создание РБС является весьма сложной задачей, поскольку для формирования суперизлучательной оптической моды необходима система из большого числа КЯ с малым разбросом геометрических параметров и малым нерадиационным уширением экситонов. В частности, для достижения резонансного коэффициента отражения более 90% оказалось необходимым создать РБС на основе $In_{0.04}Ga_{0.96}As/GaAs c 100$ периодами, каждый из которых был толщиной 115 нм [16].

Для практического использования РБС необходимо увеличить взаимодействие света с экситонами, уменьшить число периодов структуры, тем самым уменьшить общую толщину и время выращивания структуры. Для этого необходимо изменить архитектуру РБС. Определенный выигрыш в величине параметра радиационного затухания экситонов в КЯ можно получить, используя широкозонные материалы с большой энергией связи экситонов и большой высотой барьеров, обеспечивающей локализацию электронов и дырок, составляющих экситон, в малом объеме пространства. К сожалению, однако, технология выращивания структур с множественными квантовыми ямами широкозонных соединений II-VI [14] и III-нитридов [24] не позволяет получать структуры желаемого качества. Наиболее технологически совершенной, по-видимому, является система GaAs/AlGaAs. В этой системе можно реализовать достаточно глубокие квантовые ямы. Кроме того, малое рассогласование параметров решетки позволяет выращивать большое число периодов без формирования дислокаций и иных дефектов структуры. Эта система была выбрана нами для реализации РБС в данной работе, как

[¶] E-mail: chald.gvg@mail.ioffe.ru



Рис. 1. Схематическое изображение исследованной РБС. Элементарная ячейка состоит из двух близко расположенных одинаковых квантовых ям GaAs, разделеных тунельно-непрозрачным барьером AlAs. Барьеры представляют собой слой AlGaAs с содержанием AlAs 24 мол%. Толщина барьеров обеспечивает брэгговский резонанс при энергии, близкой к энергии экситонов в КЯ. Стрелки условно обозначают падающий и отраженный пучки света.

и в предшествующих работах [19,20,23]. В отличие от предшествующих работ, здесь мы использовали новый вариант периодической элементарной ячейки: она содержала две КЯ GaAs, разделенные барьером AlAs. Теоретические расчеты [10] показали, что при наличии двух ям в элементарной ячейке максимальное увеличение параметра радиационного затухания, характеризующего взаимодействие света с экситонами, составляет $\sqrt{2}$.

Итак, в данной работе мы сообщаем о создании РБС на основе системы GaAs/AlGaAs, обеспечивающей коэффициент отражения > 90% и состоящей из 60 периодов с двумя КЯ в каждой элементарной ячейке.

Исследованные структуры выращивались методом молекулярно-пучковой эпитаксии на подложках полуизолирующего GaAs диаметром 7.5 см с ориентацией (001). Структура схематически показана на рис. 1. Каждая элементарная ячейка РБС содержала две КЯ GaAs, разделенные барьером AlAs. Толщины КЯ GaAs и барьера AlAs составляли соответственно a = 7.8 нм, c = 4.8 нм. Между группами КЯ находился барьер AlGaAs с содержанием алюминия 24% и толщиной b = 97.4 нм. Точные значения толщин слоев были определены методом рентгеновской дифрактометрии высокого разрешения. Была выращена РБС с 60 периодами и референтная структура с одиночной элементарной ячейкой.

Исследование спектров оптического отражения проводилось при температурах 4, 77, 300 К в диапазоне длин волн 0.4—1.0 мкм при *s*-, *p*-поляризациях и различных углах падения света. Источником света был прибор LS-1 с вольфрамовой спиралью накаливания. Для транспорта света от источника к образцу и от образца к приемнику использовались оптоволоконные кабели. Отраженный от образцов сигнал регистрировался спектрометром HR4000CG-UV-NIR, который позволял проводить измерения в спектральном диапазоне от 200 до 1100 нм с оптическим разрешением 0.5 нм. Детектором в нем являлась кремниевая ПЗС-матрица.

На рис. 2 представлены спектры отражения света от РБС с 60 периодами и от референтного образца. Спектры записаны при нормальном падении света (угол падения $\theta = 0^{\circ}$) при температуре образцов 4.2 К. Видно, что спектры содержат серию резких особенностей на фоне плавно меняющегося отражения от поверхности образцов, определяемого формулами Френеля

$$R = \left| \frac{n_b - n_{\text{out}}}{n_b + n_{\text{out}}} \right|^2, \tag{1}$$

где n_b и n_{out} — показатели преломления барьра AlGaAs и внешней среды соответственно. Стрелками на рис. 2 отмечены особенности, связанные с экситонами с тяжелыми и легкими дырками, x(e1-hh1) и x(e1-lh1), в



Рис. 2. Спектры оптического отражения от РБС с 60 периодами (a) и от референтной структуры с одиночной элементарной ячейкой (b). Спектры записаны при 4.2 К и при нормальном падении света. Стрелками отмечены особенности, связанные с экситонами с тяжелыми и легкими дырками, x(e1-hh1) и x(e1-lh1), в КЯ и с экситонными возбуждениями в подложке GaAs и барьере AlGaAs.

КЯ GaAs и с экситонными возбуждениями в подложке GaAs и барьере AlGaAs. Видно, что энергетическое положение экситонных пиков одинаково для референтной структуры и для РБС, что показывает хорошую воспроизводимость всех элементов технологического процесса выращивания образцов.

Сравнение экситонных особенностей в спектрах *a* и *b* на рис. 2 показывает, что в структуре с 60 периодами амплутуда отражения света экситонами КЯ в несколько раз выше, чем в референтной структуре. Фактор усиления, однако, значительно меньше 60. Причина относительно небольшого увеличения коэффициента отражения света системой экситонов при весьма большом числе КЯ состоит в том, что индивидуальные экситонные состояния в КЯ отражают свет с разной фазой. Результирующий коэффициент отражения света при этом определяется интерференцией.

Еще одной спектральной особенностью на рис. 2, а является знакопеременный по отношению к фоновому отражению сигнал с максимальной амплитудой в области 1.53-1.54 эВ, быстро затухающий в области больших энергий и медленно затухающий в области малых энергий фотонов. Энергетическое положение и характерная форма этого сигнала свидетельствуют о том, что он вызван брэгговским отражением света от слоистой структуры барьер — КЯ [19,20], элементы которой имеют различные показатели преломления n_a , n_b и n_c . Резонансная длина волны (в вакууме) $\lambda_{\rm Br}$ для такого отражения определяется брэгговским условием

$$\lambda_{\rm Br} = 2d \sqrt{\left(\frac{2n_a a + n_b b + n_c c}{d}\right)^2 - \sin^2 \theta}, \qquad (2)$$

где d — период структуры, равный сумме толщин КЯ aи барьеров b и c; n_a , n_b , n_c — показатели преломления материалов КЯ и барьеров, θ — угол падения света. В спектре отражения от референтного образца брэгговский пик, конечно, отсутствует, как можно убедиться из рис. 2, a.

Условием формирования коллективной суперизлучетельной экситон-поляритонной моды в РБС является совпадение брэгговского и экситон-поляритонного резонансов. Исходя из спектров рис. 2, b, полученных при нормальном падении света, и соотношения (2), необходимое условие может быть выполнено при определенном ненулевом угле падения света θ . На рис. 3 представлены спектры отражения от РБС, записанные при 4.2 К и при углах падения света $\theta = 23, 45$ и 67°. Видно, что при увеличении угла падения брэгговский пик постепенно смещается в сторону больших энергий $E_{\rm Br} = hc/\lambda_{\rm Br}$ в соответствии с соотношением (2). Угол 23° по-прежнему соответствует энергии брэгговского резонанса, меньшей энергии экситонов в КЯ, $E_{\rm Br} < E_{x(e1-hh1)}$. При этом коэффициент брэгговского отражения в максимуме и коэффициент экситонного отражения в максимуме составляют ~ 60%. Совмещение резонансов происходит при угле падения света ~ 45°.



Рис. 3. Спектры оптического отражения от РБС с 60 периодами при 4.2 К и при различных углах падения света с *s*-поляризацией.

При этом возникает полоса отражения шириной 16 мэВ с коэффициентом отражения в максимуме > 90%. Дальнейшее увеличение угла падения света приводит вновь к расстройке брэгговского и экситон-поляритонного с экситоном x(e1-hh1) резонансов. Резонансный пик отражения расщепляется на x(e1-hh1) и брэгговскую компоненты. При $\theta = 67^{\circ}$ брэгговский резонанс совмещается с экситон-поляритонным резонансом, вызванным экситонами с легкими дырками x(e1-lh1) в КЯ. Известно (см., например, [5]), что экситоны x(e1-lh1)обладают меньшей силой осциллятора по сравнению с *x*(*e*1-*hh*1). В результате при совмещении брэгговского и экситон-поляритонного с экситоном $x(e_1-lh_1)$ резонансов полоса оптического отражения оказывается уже, максимум коэффициента отражения оказывается меньше и составляет 78%.

В работе [16] были исследованы оптические свойства РБС на основе КЯ InGaAs с барьерами GaAs с различным числом периодов. Авторы установили, что ширина резонансной полосы отражения РБС для системы из 60 КЯ составляет ~ 4 мэВ, а для системы из 100 КЯ ~ 6 мэВ. Полученная нами полоса резонансного отражения оказалась значительно шире — 16 мэВ.

Ширина полосы оптического отражения в резонансных условиях определяется двумя вкладами. Во-первых, это отражение света от виртуальной слоистой структуры без экситонов вследствие различия коэффициентов преломления в КЯ и барьерах. Оценки показывают, что для структуры на основе GaAs/AlGaAs, исследованной в данной работе, такое отражение должно быть больше, чем для структур на основе InGaAs/GaAs, исследованных в работе [16]. Во-вторых, отражение света периодической системой экситоной в КЯ определяется параметром радиационного затухания экситонных состояний в КЯ, числом и расположением КЯ [10]. Использование системы GaAs/AlGaAs обеспечивает бо́льшую энергию связи и более сильную локализацию экситонов в квантовых ямах, что увеличило параметр радиационного затухания до $\Gamma_0 \approx 40$ мэВ в нашем случае [23] по сравнению с 27 мэВ в работе [16] для системы InGaAs/GaAs. Кроме того, использование двух близко расположенных КЯ в элементарной ячейке должно дополнительно эффективно увеличивать параметр Го и соответственно увеличивать ширину экситонной резонансной полосы в ~ $\sqrt{2}$ раз [10]. Таким образом, качественный анализ показывает, что значительно бо́льшая ширина резонансной полосы в РБС на основе GaAs/AlGaAs по сравнению с РБС на основе InGaAs/GaAs вызвана увеличением как экситонного, так и неэкситонного вкладов. Для количественного анализа этих вкладов необходимо численное моделирование оптических свойств, которое будет проведено в последующих работах.

Можно заключить, что нами получены и исследованы РБС, состоящие из 60 пар квантовых ям GaAs, разделенных барьерами AlGaAs. Установлено, что в резонансных условиях, обеспечивающих формирование оптической решетки экситонов x(e1-hh1) в КЯ, полученные РБС являются эффективными брэгговскими отражателями с шириной полосы 16 мэВ и коэффициентом отражения света в максимуме более 90%. Оптическая решетка экситонов x(e1-lh1) в КЯ является менее эффективной, создавая более узкую полосу с коэффициентом отражения в максимуме 78%.

Авторы благодарны М.А. Яговкиной за рентгеноструктурные исследования образцов, Е.Л. Ивченко, А.Н. Поддубному, М.М. Воронову да полезные дискуссии.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований, грант № _11-02-12238-офи-м, и Российской академией наук.

Список литературы

- J.D. Joannopulos, R.D. Meade, J.N. Winn. *Photonic Crystals: Molding the Flow of Light* (Princeton University Press, Princeton, 1995).
- [2] Vertical Cavity Surface Emitting Lasers, ed. by L.A. Coldren, H. Temkin, and C.W. Wilmsen (Cambridge University, Cambridge, 1999).
- [3] А.Б. Певцов, С.А. Грудинкин, А.Н. Поддубный, С.Ф. Каплан, Д.А. Курдюков, В.Г. Голубев. ФТП, 44, 1585 (2010).
- [4] Е.Л. Ивченко, А.И. Несвижский, С. Йорда. ФТТ, 36, 2118 (1994).
- [5] E.L. Ivchenko. Optical spectroscopy of semiconductor nanostructures (Alpha Science International, Harrow, UK, 2005).
- [6] E.L. Ivchenko, M. Willander. Phys. Status Solidi B, 215, 199 (1999).
- [7] L.I. Deych, A.A. Lisyansky. Phys. Rev. B, 62, 4242 (2000).
- [8] T. Ikawa, K. Cho. Phys. Rev. B, 66, 85338 (2002).

- [9] L. Pilozzi, A. D'Andrea, K. Cho. Phys. Rev. B, **69**, 205311 (2004).
- [10] E.L. Ivchenko, M.M. Voronov, M.V. Erementchouk, L.I. Deych, A.A. Lisyansky. Phys. Rev. B, 70, 195106 (2004).
- [11] М.М. Воронов, Е.Л. Ивченко, А.Н. Поддубный, В.В. Чалдышев. ФТТ, 48 (9), 1814 (2006).
- [12] M.V. Erementchouk, L.I. Deych, A.A. Lisyansky. Phys. Rev. B, 73, 115321 (2006).
- [13] М.М. Воронов, Е.Л. Ивченко, В.А. Кособукин, А.Н. Поддубный. ФТТ, 49 (9), 1709 (2007).
- [14] Е.Л. Ивченко, В.П. Кочерешко, А.В. Платонов, Д.Р. Яковлев, А. Вааг, В. Оссау, Г. Ландвер. ФТТ, **39**, 2072 (1997).
- [15] M. Hübner, J. Kuhl, T. Stroucken, A. Knorr, S.W. Koch, R. Hey, K. Ploog. Phys. Rev. Lett., 76, 4199 (1996).
- [16] M. Hübner, J.P. Prineas, C. Ell, P. Brick, E.S. Lee, G. Khitrova, H.M. Gibbs, S.W. Koch. Phys. Rev. Lett., 83, 2841 (1999).
- [17] G.R. Hayes, J.L. Staehli, U. Oesterle, B. Deveaud, R.T. Phillips, C. Ciuti. Phys. Rev. Lett., 83, 2837 (1999).
- [18] J.P. Prineas, C. Ell, E.S. Lee, G. Khitrova, H.M. Gibbs, S.W. Koch. Phys. Rev. B, 61, 13863 (2000).
- [19] В.В. Чалдышев, А.С. Школьник, В.П. Евтихиев, Т. Holden. ФТП, 40 (12), 1466 (2006).
- [20] В.В. Чалдышев, А.С. Школьник, В.П. Евтихиев, Т. Holden. ФТП, 41 (12), 1455 (2007).
- [21] D. Goldberg, L.I. Deych, A.A. Lisyansky, Z. Shi, V.M. Menon, V. Tokranov, M. Yakimov, S. Oktyabrsky. Nature Photonics, 3, 662 (2009).
- [22] J.P. Prineas, C. Cao, M. Yildirim, W. Johnston, M. Reddy. J. Appl. Phys., 100, 063101 (2006).
- [23] V.V. Chaldyshev, Y. Chen, A.N. Poddubny, A.P. Vasil'ev, Z. Liu. Appl. Phys. Lett., 98, 073112 (2011).
- [24] V.V. Chaldyshev, A.S. Bolshakov, E.E. Zavarin, A.V. Sakharov, W.V. Lundin, A.F. Tsatsulnikov, M.A. Yagovkina, T. Kim, Y. Park. Appl. Phys. Lett., 99, 251103 (2011).

Редактор Л.В. Шаронова

Resonant light reflection by a periodic system of excitons in GaAs/AlGaAs quantum wells

V.V. Chaldyshev, E.V. Kundelev⁺, E.V. Nikitina^{*}, A.Yu. Egorov^{*}, A.A. Gorbatsevich^{*}

Ioffe Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, 194021 St. Petersburg, Russia ⁺ St. Petersburg State Polytechnic University, 195251 St. Petersburg, Russia * St. Petersburg Academic University,

194021 St. Petersburg, Russia

Abstract A study has been done of the optical reflection spectra from periodic structures with two quantum wells in the elementary cell. The dependencies of the Bragg and exciton–polariton reflection on the angle of the light incidence, polarization and temperature were studied. An analysis of the experimental data showed that the sample with 60 cells is a good distributive Bragg reflector with reflectivity more than 90% in the maximum of the spectral band, having width of 16 meV.